

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2009-104952

(P2009-104952A)

(43) 公開日 平成21年5月14日(2009.5.14)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H05B 33/12 (2006.01)	H05B 33/12 B	3K107
H05B 33/22 (2006.01)	H05B 33/22 Z	
H05B 33/04 (2006.01)	H05B 33/04	
H05B 33/26 (2006.01)	H05B 33/26 Z	
H01L 51/50 (2006.01)	H05B 33/14 A	

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 16 頁)

(21) 出願番号 特願2007-276816 (P2007-276816)
 (22) 出願日 平成19年10月24日 (2007.10.24)

(71) 出願人 000005234
 富士電機ホールディングス株式会社
 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
 (74) 代理人 100096714
 弁理士 本多 一郎
 (74) 代理人 100124121
 弁理士 杉本 由美子
 (72) 発明者 仲村 秀世
 東京都日野市富士町1番地 富士電機アド
 バンストテクノロジー株式会社内
 Fターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC23 CC29 CC43
 CC45 DD37 DD89 DD91 EE42
 EE55

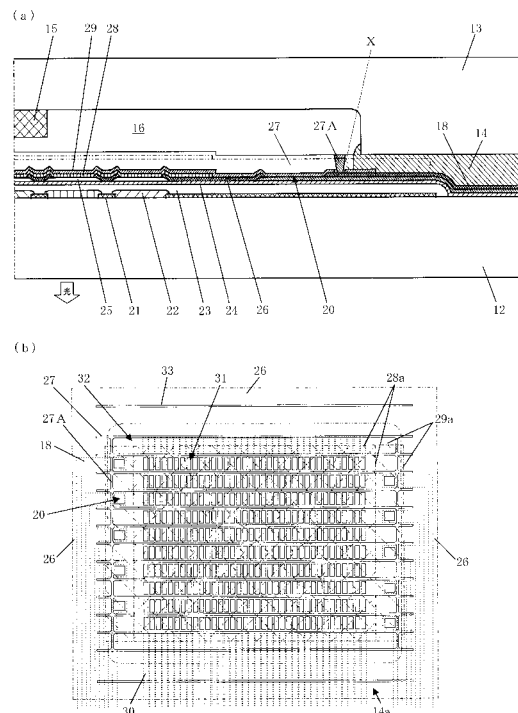
(54) 【発明の名称】 有機ELディスプレイパネル

(57) 【要約】

【課題】安価で精度の悪い位置決め装置やマスクを用いた場合でも、長寿命であって機器に組み込みやすく、歩留まりが良好で、かつ、安価な有機ELディスプレイパネルを提供する。

【解決手段】ストライプ状に形成された透明電極25と、各画素の発光領域を画成する絶縁膜26と、透明電極に対し直交する方向に形成された反射電極隔壁27と、反射電極隔壁により分離された有機EL層28および反射電極29とを順次備える有機EL素子を有する有機EL基板12、および、封止基板13が、反射電極隔壁27をスペーサとして、接着部14を介して貼り合わさる有機ELディスプレイパネルである。封止基板13が接着部14の内側にザグリ部16を有し、かつ、反射電極隔壁27が、反射電極29と外部配線18との電氣的接続部20より外側であってザグリ部16端部より内側の位置に、隣接する隔壁27間を直交する方向に繋ぐ補助隔壁部27Aを有する。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

少なくとも、ストライプ状に形成された透明電極と、各画素の発光領域を画成する絶縁膜と、該透明電極に対し直交する方向に形成された反射電極隔壁と、該反射電極隔壁により分離された有機 E L 層および反射電極とを順次備える有機 E L 素子を有する有機 E L 基板、および、封止基板が、前記反射電極隔壁をスペーサとして、接着部を介して貼り合わされてなる有機 E L ディスプレイパネルにおいて、

前記封止基板が前記接着部の内側にザグリ部を有し、かつ、前記反射電極隔壁が、前記反射電極と外部配線との電氣的接続部より外側であって前記ザグリ部端部より内側の位置に、隣接する隔壁間を直交する方向に繋ぐ補助隔壁部を有することを特徴とする有機 E L ディスプレイパネル。

10

【請求項 2】

前記補助隔壁部が、前記反射電極隔壁との交差部において R 形状を有する請求項 1 記載の有機 E L ディスプレイパネル。

【請求項 3】

前記絶縁膜が無機材料からなる請求項 1 または 2 記載の有機 E L ディスプレイパネル。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、表示装置として用いられる有機 E L (エレクトロルミネセンス) ディスプレイパネル (以下、単に「パネル」とも称する) に関する。

20

【背景技術】

【0002】

従来の有機 E L ディスプレイパネルの基板構造、特に、パッシブ方式のボトムエミッション構造を、図 8、図 9 に示す。図 8 (a) ~ (c) は、有機 E L ディスプレイパネルの全体構造を示しており、有機 E L 等の積層膜 111 を有する有機 E L 基板 (ガラス) 112 と、封止基板 (ガラス) 113 とが、外周に設けられた接着部 114 ((c) ではガラスを通して見たシール領域 114a を示す) を介して貼り合わされたものである。図示する封止基板 113 には、接着部 114 の内側に、内部に吸湿剤 115 を配置したザグリ部 116 が設けられている。また、図中、符号 117 は表示部を、符号 118 は陰極配線 (外部配線) を、符号 119 は電極端子の取り出し部を、それぞれ示している。

30

【0003】

図 9 (a) は、従来構造のパネル内部を部分的に拡大して示す模式的断面図、同図 (b) は、このパネル内の平面構造パターンの一例である。この従来のパネルの層構成としては、まず、ガラス基板 112 上にブラックマトリクス (BM) 121 およびカラーフィルタ (CF) または CF + 色変換 (CCM) 層 122 が形成されている。次いで、CF や色変換層の凹凸を平坦化するための平坦化層 (OCL) 123 が設けられ、さらに、ここまでの層からの水分の染み出しを防ぐためのパッシベーション層 124 が形成される。次いで、この上に、陰極配線 118、陽極 (透明電極) 125、有機絶縁膜 126、陰極隔壁 127 (有機材料) が形成され、有機発光層 128 および反射電極 129 が順次成膜される。なお、一般に反射電極は陰極であるので、ここでは、反射電極 = 陰極と表現するが、反転構造で陽極となることも考えられるので、陰極、陽極の別に特に制限はない。

40

【0004】

陰極 129 は、陰極隔壁 127 により走査線ごとに分離され、絶縁膜 126 の端部の開口 (陰極接続部 120) で陰極配線 118 に接続する。この場合、陰極端子の引き出しは、この接続部からストレートに (陽極配線と直角の方向に) 行うことが最も簡単であるが、パネルにおける画面の外側の周縁部分、いわゆる額縁の低減、および、フレキシブルプリント基板 (FPC) の接続工数削減のために、図 8 に示す端子取り出し部 119 のように、1 方向からまとめて引き出す方法もある。また、この引き出し部に制御 IC を実装する場合もある。さらに、より額縁を小さくする観点からは、図 9 (b) に示すように、陰

50

極配線 1 1 8 を両側に交互に半数ずつ引き出すことが一般的である。なお、図中、符号 1 2 8 a は有機発光層の成膜範囲を、符号 1 2 9 a は反射電極の成膜範囲を示す。また、符号 1 3 0 は陽極配線を示すが、発光部開口 1 3 1 付近については、分かりにくくなるので図示しない。

【 0 0 0 5 】

また、有機 E L ディスプレイパネル、特にボトムエミッション構造の場合の一般的な封止構造も、図 8 に示すとおりである。有機 E L 層は、酸素や水分に極めて弱いため、大気中に暴露すると、直ぐに発光しなくなる。そこで、酸素や水分を極限まで抑えたチャンパー内において、さらに、吸湿剤 1 1 5 を内蔵させた状態で、ガラスなどの封止基板 1 1 3 で封止している。封止基板 1 1 3 の接合（外周シール）には、例えば、紫外線で硬化する接着剤などが使用される。

10

【 0 0 0 6 】

また、一般的な封止基板では、有機 E L 等の積層膜に触れないようにするため、および、吸湿剤 1 1 5 が入る空間を確保するために、図示するように、有機 E L 等の積層膜に対向する位置にザグリ加工が施されている。そして、基板間の接着部 1 1 4 については、水分の通り道を作らないために、有機 E L 基板の有機材料のパターンには一切触れない位置に配置するのが通例である。図 1 0 に、接着部の形成位置による水分の透過経路の違いを示す。図中の（ a ）は図 9（ a ）と同様の位置に接着部を形成した場合、（ b ）はより内側に接着部を形成した場合であり、いずれも、陰極配線 1 1 8 がない位置（陰極接続部上でない位置）での断面図を示す。また、（ b ）中の点線で示す水分透過経路は、陰極隔壁内を通るものである。

20

【 0 0 0 7 】

有機 E L ディスプレイパネルに係る改良技術としては、例えば、特許文献 1 に、ITO ストリップ、補助電極、有機 E L 層、陰極ストリップからなる発光セルと、この発光セルを陰極ストリップから絶縁する隔壁が形成された有機 E L ディスプレイパネルにおいて、この隔壁の間に、隔壁間を繋ぐ少なくとも一つ以上の補助隔壁を形成する技術が開示されている。また、特許文献 2 には、複数の発光部からなる画像表示配列を有し、基板と、基板上に並行に配置された複数の第一電極と、第一電極の電極パターン上に形成された有機物質からなる電界発光層と、電界発光層上に形成され複数の第一電極と直交する複数の第二電極と、絶縁膜とその上に形成された逆テーパ形状を成すレジストとから形成された電気絶縁性の隔壁とを備え、この隔壁が、第二電極の電極パターンのギャップ部分に設けられた隔壁ライン部と、この隔壁ライン部の端部である隔壁ライン端部とからなり、該隔壁ライン端部が互いに連結されてなる有機薄膜発光素子が開示されている。

30

【特許文献 1】特開 2 0 0 4 - 3 1 9 5 1 0 号公報（特許請求の範囲等）

【特許文献 2】特許 3 7 3 6 1 7 9 号公報（特許請求の範囲等）

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【 0 0 0 8 】

しかしながら、図 8 に示すような従来構造のパネルにおいては、十分なシール幅を確保することと、有機 E L 基板上の有機材料からなるパターンに接着剤が一切触れないためのクリアランスを確保することとを両立させるために、額縁が大きくなってしまいうという問題があった。額縁が大きくなると、パネルを機器に組み込み難いという寸法上の制約が厳しくなるのみならず、マザー基板からのパネル取れ数が減るため、コスト高ともなる。

40

【 0 0 0 9 】

一方、この額縁を決める要因としては、上記シール幅およびクリアランス以外に、有機発光層の成膜位置ズレ、陰極接続部の開口寸法、反射電極（陰極）の成膜位置ズレがある。中でも、成膜位置ズレは、通常、主に蒸着用メタルマスクの精度とその位置合わせ精度で決まるが、額縁を小さくするために、これを高精度化すればするほど、メタルマスクや蒸着（アライメント）装置が高価になってしまう。

【 0 0 1 0 】

50

特に、反射電極、すなわち陰極用金属材料の蒸着に関しては、温度上昇が大きく、マスクと基板との間でパターズレが起こりやすい。これを克服して、例えば、数 μm ～数十 μm の位置合わせ精度を達成することも可能であるが、その場合、極薄低熱膨張材料を使った特殊なマスクや、蒸着装置内の部分冷却装置、さらには、高精度アライメント機構や、マスクと基板とを密着させるためのマグネット機構などが必要となり、これらはコスト増大要因となる。なお、このマスクと基板とを密着させることでは、パーティクルが付着してリークが増加するという新たな問題が発生する可能性もある。反射電極の成膜精度（マスク加工精度＋位置合わせ精度＋パターンボケ）を数百 μm （ $\pm 500\mu\text{m}$ ～ $\pm 700\mu\text{m}$ 程度）で許容できるならば、通常のエッチング加工等による安価なマスクと、外形や基準ピン合わせ等による低コストアライメント機構を用い、さらには、マスクと基板を密着させない成膜も可能である。

10

【0011】

したがって、パネルにおいて良好なコスト性を確保する観点からは、成膜精度が悪い場合、すなわち、反射電極の成膜位置にズレが生じた場合であっても、反射電極の成膜位置にとらわれずに、接着領域をできるだけ内側として、額縁の縮小を図ることが有効である。

【0012】

しかし、図10(b)に示す場合のように、単純に接着領域を内側にすると、水分の透過経路ができて、パネル寿命が低下してしまう。また、図11の写真図（金属顕微鏡写真、隔壁間距離300 μm ）に示すように、陰極隔壁の、特に逆テーパ断面の根元の隙間に沿って、毛細管現象で接着剤が内部に浸入するという現象を避けて通れない。この接着剤が有機発光膜に触れると、有機発光膜に対し、水分の浸入以上に深刻なダメージを与えることとなる。

20

【0013】

この接着剤の浸入防止に対しては、例えば、特許文献1のように、陰極隔壁を複雑な補助隔壁でつなぐことも提案されている。しかし、特許文献1における補助隔壁は、接着剤の浸入を防ぐ目的においては有効であるものの、複雑で額縁の増大を招く構造であるといえる。また、平板封止を想定しており、シール幅が正確に決まらないため、額縁の縮小が難しい構造であると考えられる。さらに、水分が接着剤から有機絶縁膜を通して内部に浸入することが考慮されていない。なお、水分に関しては、通常、接着剤自体にも、無視できない量が含まれている。

30

【0014】

また一方、シール性能確保のために、従来と同等レベル（数 μm ギャップ）まで接着剤を押しつぶすことを考える場合、接着剤中にスペーサとしてビーズなどを混入させておくと、絶縁膜などのパターンを傷つけるおそれがある。そのため、有機EL基板の陰極隔壁自体をスペーサとして利用し、これに接触するまで封止基板を近づけることで、両基板間のギャップを確保する手法を採用することになる。

【0015】

しかしながらこの場合、陰極用金属膜に、接着剤や封止基板が接触するおそれが生ずる。すなわち、隔壁により分離したはずの陰極用金属膜が、接着剤の流動、または、封止基板（特に、ザグリ部端の角部）に当たるなどして剥がれ、隣接する走査線と短絡して、不良となるのである。陰極用金属膜は、絶縁膜上にも陰極隔壁上にも成膜されるが、これらは極めて密着力が弱く剥がれやすい。この点、前記特許文献1のパネルは、陰極用金属膜がシール部に接触しない構造であるし、封止基板を陰極隔壁付近まで押し潰す構造でもないことから、走査線同士の短絡防止については考慮していない。また、特許文献1に係る補助隔壁は、接着剤の流動阻止を目的として、曲がった形状や複雑な突起形状に形成されており、このような部分（特に、尖った部分）でも短絡が起こりうると考えられる。従って、特許文献1の構造では不十分であり、陰極用金属膜に接着剤や封止基板が接触するような場合でも、陰極を電氣的にも確実に分離できる構造が必要となる。

40

【0016】

50

そこで本発明の目的は、上記問題を解消して、安価で精度の悪い位置決め装置やマスクを用いた製造方法を用いても、水分の透過経路や接着剤の浸入経路を作ることなく、かつ、陰極短絡などの不良を発生させることなく、接着領域をできるだけ内側として、額縁を小さくすることができる有機ＥＬディスプレイパネルを提供することにある、ひいては、長寿命であって機器に組み込みやすいことに加え、歩留まりが良好で、かつ、安価な有機ＥＬディスプレイパネルを提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【００１７】

本発明者は鋭意検討した結果、封止基板にザグリ溝を設けて接着部の位置を規定するとともに、この接着部より内側であって陰極と外部配線との接続部より外側に、陰極隔壁と直交する方向に直線的な隔壁パターンを形成し、これを陰極隔壁と繋ぐことで、上記課題を解決できることを見出して、本発明を完成するに至った。

10

【００１８】

すなわち、本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、少なくともストライプ状に形成された透明電極と、各画素の発光領域を画成する絶縁膜と、該透明電極に対し直交する方向に形成された反射電極隔壁と、該反射電極隔壁により分離された有機ＥＬ層および反射電極とを順次備える有機ＥＬ素子を有する有機ＥＬ基板、および、封止基板が、前記反射電極隔壁をスペーサとして、接着部を介して貼り合わされてなる有機ＥＬディスプレイパネルにおいて、

前記封止基板が前記接着部の内側にザグリ部を有し、かつ、前記反射電極隔壁が、前記反射電極と外部配線との電氣的接続部より外側であって前記ザグリ部端部より内側の位置に、隣接する隔壁間を直交する方向に繋ぐ補助隔壁部を有することを特徴とするものである。

20

【００１９】

本発明において、前記補助隔壁部は、好適には、前記反射電極隔壁との交差部においてＲ形状を有するものとする。さらに、前記絶縁膜は、無機材料からなるものとするのが好ましい。

【００２０】

なお、前記特許文献２には、平行な陰極隔壁端部で、これに直交する太いパターンにより全部をつなぐ構造が提案されているが、これは、陰極隔壁の剥離防止を目的としたものであって、この構造では、接着剤の浸入も陰極短絡も防止できない。また、特許文献２は、有機ＥＬ基板側にのみ着目した技術であり、封止基板との接着に関しては何ら考慮されていない。

30

【発明の効果】

【００２１】

本発明によれば、上記構成としたことにより、安価で精度の悪い位置決め装置やマスクを用いた製造方法を用いても、水分の透過経路や接着剤の浸入経路を作ることなく、かつ、陰極短絡などの不良を発生させることなく、接着領域をできるだけ内側として、額縁を小さくした有機ＥＬディスプレイパネルを実現することが可能となった。本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、長寿命であって機器に組み込みやすいことに加え、歩留まりが良好で、かつ、安価であるというメリットを有するものである。

40

【発明を実施するための最良の形態】

【００２２】

以下、本発明の好適実施形態について、図面を参照しつつ詳細に説明する。

図１（ａ）は、本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの一好適例に係る画面端部の内部構造を示す模式的断面図であり、（ｂ）は、その平面構造を示す模式図である。また、図２は、図１（ｂ）に示す平面構造の一部を拡大した模式図である。

【００２３】

図示するように、本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、有機ＥＬ基板１２と封止基板１３とが、反射電極隔壁２７をスペーサとして、接着部（シール部）１４を介して貼り

50

合わされてなる。

【0024】

図示するパネルにおいて、ガラス等からなる有機EL基板12上には、ブラックマトリクス21、カラーフィルタまたはCF+色変換層22および平坦化層23が順次設けられ、これら層上にはパッシベーション層24が形成されている。このパッシベーション層24上には、陰極用の外部配線18、透明電極(陽極)25、絶縁膜26、反射電極隔壁27(有機材料)が順次形成されており、さらに、有機発光層28および反射電極(陰極)29が順次成膜される。また、符号18, 30は外部配線を示しており、符号28aは有機発光層の成膜範囲を、符号29aは反射電極の成膜範囲を、符号31は発光部開口を、符号32はダミー走査線部を、それぞれ示す。なお、前述したように、本発明において、陰極、陽極の別に特に制限はない。

10

【0025】

本発明においては、図示するように、封止基板13が接着部14の内側にザグリ部16を有するとともに、反射電極隔壁27が、反射電極29と外部配線18との電氣的接続部20より外側であってザグリ部16の端部より内側の位置に、隣接する隔壁27間を直交する方向に繋ぐ補助隔壁部27Aを有している。

【0026】

かかる補助隔壁部27Aを設けたことにより、これより外側に接着部14がある限り、有機EL素子近傍への接着剤の浸入を防止することができる。また、この補助隔壁部27Aは、細い直線パターンで形成することができるので、額縁増加にはつながらない。一方で、本発明においては、封止基板13にザグリ部16が形成されているため、このザグリ部16の位置により、シール領域を制御することができる。これは、貼り合わせ時にシール部から接着剤がはみ出たとしても、ザグリ部16があることにより、余った接着剤は縦方向(ザグリ部16内)に広がって、大きく横方向(すなわち、内側の有機EL素子部分)に広がることなくするためである。そのため本発明では、シール領域を極力内側として、補助隔壁部27Aに極めて近いところまでシール領域を狭めることが可能となる。ザグリ部を設けない場合、シール幅の制御が十分できないので、接着剤が内部に浸入するリスクが高くなり、結果としてシール領域をあまり内側にすることはできない。

20

【0027】

また、図示するように、補助隔壁部27Aは反射電極隔壁27と繋がっているもので、接着部14付近において、接着剤の流動や封止基板の接触により陰極用蒸着金属膜が剥がれて、部分的に短絡した場合でも、画面部分とは電氣的に絶縁することができる。

30

【0028】

本発明に係る補助隔壁部27Aは、途中に屈曲部を設けたり、付属物をつけるなどすると、額縁低減につながらないため、単純な直線構造とすることが最も好ましい。より好ましくは、反射電極隔壁27と同じ幅で形成する。このような単純な直線構造の隔壁およびザグリ部を設けたパネル構造により、画素サイズ程度のスペースで接着剤の浸入防止が可能となることを実証した例を、図3(金属顕微鏡写真, 隔壁間距離180 μ m)の写真図に示す。従って、本発明によれば、特許文献1のような複雑な陰極隔壁形状は、不要であって、逆に額縁低減の目的には不向きであることがわかる。また、かかる単純な直線構造では、曲がりや突起がないので、ここでの短絡の確率も小さくなる。なお、本発明において補助隔壁部27Aは、反射電極隔壁27に対し直交する方向に設けられるが、正確に直交している必要はなく、形成位置の誤差範囲内程度で、多少斜めであってもよい。

40

【0029】

これにより、従来は陰極成膜範囲の位置ズレの余裕を見込んで設けられていた額縁の一部を、シール領域と共有することが可能となるため、成膜精度向上のための陰極用メタルマスクコストや蒸着装置コストを削減することができる。また、額縁が小さくなって、外形が小型になり、マザー基板内の取れ数も増大するので、この点でもコストを低下できる。

【0030】

50

なお、本発明においては、シール領域に用いる接着剤に、シール高さを揃えるためのビーズ材等を混入させないことが望ましい。本発明では、シール領域をパターン上に設けるので、接着剤中にビーズ材等の異物があると、絶縁膜やパッシベーション膜などのパターンを傷つけるおそれがあるからである。そのため本発明では、反射電極隔壁 27 をスペーサとして、ビーズ材等の使用を不要としており、これにより接着剤コストの低減効果も得られる。

【0031】

ここで、スペーサとしての反射電極隔壁 27 と封止基板との接触部は、基本的には、図 1 (a) の断面図に示すように、隔壁 27 の端部のみでよいが、例えば、図 1 (b) に示すように、シール領域 14 a の中央に反射電極隔壁 27 と同じ材料からなるスペーサ 33 を形成してもよい。ここで、スペーサ 33 をシール領域 14 a の中央部に設置しているのは、接着剤の広がりを最も阻害しないからである。また、ブラックマトリクスや平坦化層などのパターン位置によっては、反射電極隔壁 27 とスペーサ 33 との頂上高さが違ってくるが、シール高さの極端なバラツキを抑える目的には有効である。これ以外にも、多数個取り基板の場合であれば、スペーサをシール領域の外に設けてブレイク後に捨ててもよいし、スペーサ 33 の下に平坦化層のダミーパターンを置いて、高さを合わせてもよい。なお、シール高さのバラツキ低減を目指すのは、封止形状の安定につながるからである。

【0032】

また、本発明において、反射電極隔壁 27 は、図示するように、反射電極 29 よりも外側まで延在して、スペーサとして機能させることが好ましい。すなわち、本発明のパネルにおいて好適には、図示するように、パネル中央部から順に、反射電極 29 と外部配線 18 との電氣的接続部 20、補助隔壁部 27 A、封止基板のザグリ部 16 端部、反射電極 29 の成膜端部の順で配置されることになる。

【0033】

さらに、本発明において、補助隔壁部 27 A と反射電極隔壁 27 との交差部は、図示するように、R 形状を有するものとするのが好ましい。互いに直交して繋がっている隔壁パターンの付け根に R 形状を設けることで、隔壁形成時の露光および現像を安定させることができ、確実に反射電極を分離することが可能となる。

【0034】

本発明においては、上記補助隔壁部 27 A を設けた点のみが重要であり、それ以外のパネル構造の詳細や用いる材料等については、常法に従い適宜構成することができ、特に制限されるものではない。なお、本発明のパネル構造は、高精度な成膜を行わなくても額縁を大きく減らせる構造であるが、高精度な成膜を行う場合に適用しても、さらに額縁を低減できる構造であることはいうまでもない。

【0035】

なお、本発明において、反射電極隔壁 27 は、有機材料または無機材料のいずれを用いて形成してもよいが、パターンングや逆テーパ形状の形成が容易である点で、有機材料を用いることが安価で望ましい。具体的には例えば、ノボラック系有機レジスト材料などが、使いやすく好適である。また、補助隔壁部 27 A についても、反射電極隔壁 27 と同様の材料で、反射電極隔壁 27 と同時に形成することができる。

【0036】

また、発光部開口を形成する絶縁膜 26 は、本発明の効果をより良好に得る観点からは、無機材料からなる無機絶縁膜とすることが好ましい。通常の有機材料からなる絶縁膜ではなく無機絶縁膜を用いることで、図 4 の拡大図に示すように、接着剤が絶縁膜 26 や反射電極隔壁 27 に触れた場合や、有機材料の反射電極隔壁 27 を通って水分が浸入した場合でも、有機発光層 28 までの水分の透過経路ができない。なお、反射電極隔壁 27 からしみ出た水分は、吸湿剤 15 により吸収される。

【0037】

無機絶縁膜の材料としては、 SiO_x 、 SiN 、 SiON などを好適に用いることができ、マザー基板全面にスパッタ装置または CVD 装置などを用いて成膜することができる

10

20

30

40

50

。開口部は、画素発光部、陰極接続部、端子部などに設けるが、その形成方法としては、ドライエッチングを用いることが望ましい。

【0038】

図5に、本発明のパネルの製造工程を概略的に示す。図示するように、本発明のパネルの製造工程は、ブラックマトリクスからパッシベーション層までが積層された積層膜50上へのストライプ状の透明電極25、および、陰極用の外部配線18の形成(図中の工程(a))までは、従来と同様に行うことができる。次いで、この上に、発光部開口を形成するための絶縁膜26を形成する(図中の工程(b))。絶縁膜26には、前述したように、成膜後に、ドライエッチング等により開口部を形成することができる。次いで、フォトリソグラフィ法により、反射電極隔壁27、補助隔壁部27A、および、所望に応じスペーサ33を形成する(図中の工程(c))。次いで、有機発光層28を蒸着し(図中の工程(d))、反射電極29用金属膜を蒸着した後に(図中の工程(e))、封止基板13と貼り合わせることで、本発明のパネルを得ることができる(図中の工程(f))。

10

【0039】

この際、有機EL多数取り用基板を用いてパネルの製造を行う場合には、例えば、図6に示すような、ザグリ部41を複数設けた封止基板42を用いることができる。また、これを用いて製造された多数取り用基板の場合の封止後のパネル構造の概略を、図7(a)~(c)に示す。図示する例は、有機EL多数取り用基板43と封止基板42とを貼り合わせた状態を示し、これら有機EL多数取り用基板43および封止基板42はそれぞれ、符号51, 52で示す切断位置で切断される。

20

【実施例】

【0040】

以下、本発明を、実施例を用いてより詳細に説明する。

<実施例1>

(封止基板)

図6に示すような封止基板を、厚さ0.7mmの無アルカリガラス(日本電気硝子(株)製, OA-10)を用いて製作した。サンドブラスト法を採用して形成したザグリ部の深さは、約0.3mmであった。これら個々のザグリ部に、シートから打ち抜いて製作した10mm×20mm×0.2mm tの吸湿材を、1個ずつ接着した。

30

【0041】

(有機EL基板)

厚さ0.7mmの無アルカリガラス基板(コーニング社製, Eagle 2000)に、ブラックマトリクス、カラーフィルタ、色変換層および平坦化層を順次形成した後、これらから出る水分を遮断するための厚さ約300nmのSiO₂のパッシベーション層を、スパッタ法により形成した。スパッタ装置としてはRF-プレーナマグネトロンを用い、ガスはArを使用した。形成時の基板温度は80℃で行った。

【0042】

上記のようにして製造した基板の上に、陽極/正孔注入層/正孔輸送層/有機発光層/電子注入層/陰極を順次成膜して、有機EL発光機能を形成した。

40

【0043】

まず、パッシベーション層の上面に厚さ400nmのMo膜をスパッタ法で形成し、ウェットエッチングにて外部配線のパターンを形成した。この配線パターンは、陰極金属との接続位置から端子部まで伸びていた。この上に、スパッタ法にて、透明電極用IZO膜を、厚さ約200nmで全面成膜した。IZO膜上にレジスト剤(東京応化(株)製, OFPR-800)を塗布した後、フォトリソグラフィ法にてパターンニングを行い、それぞれの色の発光部(赤色, 緑色, および青色)の陽極を得た。

【0044】

この上に、CVD法で、無機絶縁膜としてのSiNを厚さ300nmにて成膜し、レジスト膜を塗布して、フォトリソグラフィ法により、発光させる部位や陰極接続部、端子部などにレジスト膜の窓を開けた。その後、ドライエッチャーを用いて、SiN膜下のIZO

50

およびMo配線を露出させた。次いで、これによって形成された開口部のレジスト変質部を取り除く目的でアッシングを行い、剥離液で全体のレジスト剤を除去した。

【0045】

次に、フォトリソグラフ法を用いて、IZOのデータライン上に並んだ無機絶縁膜の窓と窓との隙間に、IZOラインと直交する方向に陰極隔壁（反射電極隔壁に相当する）を形成して、マトリックス駆動の構造を形成した。但し、陰極隔壁は、図1に示すように、陰極と外部配線との接続部より外側であってザグリ部端部より内側に相当する位置に、隣接する隔壁間を直交する方向に繋ぐ補助隔壁部を有するとともに、陰極と外部配線との接続部より外側においても陰極が形成される領域より外側まで延在するよう設けた。陰極隔壁の材料としては、ノボラック系有機レジスト材料を用い、露光時間を調整することで、上面が約12μm幅、底面が約6μm幅、高さ約4μmの逆テーパ形状とした。陰極隔壁の各コーナー部には、できるだけ大きいR形状を設けて露光と現像を安定させ、断面がどこでも確実に逆テーパ形状になるようにした。

10

【0046】

次に、この基板を抵抗加熱蒸着装置内に装着し、正孔注入層、正孔輸送層、有機発光層および電子注入層を、真空を破らずに順次成膜した。成膜に際して真空槽内圧は 1×10^{-4} Paまで減圧した。正孔注入層としては、銅フタロシアニン(CuPc)を厚さ100nmにて積層した。正孔輸送層としては、4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ピフェニル(-NPD)を厚さ20nmにて積層した。有機発光層としては、4,4'-ビス(2,2'-ジフェニルビニル)ピフェニル(DPVBi)を厚さ30nmにて積層した。電子注入層としては、アルミキレート(Alq)を厚さ20nmにて積層した。

20

【0047】

その後、前述の陰極隔壁を利用して、陽極(IZO)のラインと直交するストライプパターンが得られるように、厚さ100nmのAl電極を真空を破らずに蒸着し、陰極（反射電極に相当する）を得た。Al電極の膜は、陰極接続部より外側にまではみ出したが、その部分は、補助隔壁部によって、電氣的に完全に遮断された。

【0048】

なお、これらの蒸着には、エッチングにより個々のパネルの画面全体が入るようなエリア開口を設けただけの安価なメタルマスクと、メカニカルな位置合わせ機構（ガイドピン+外形合わせ）を使用した。基板とメタルマスクとの間には0.2mmの空隙があり、接触はさせなかった。結果として、その成膜精度（マスク加工精度+位置合わせ精度+パターンボケ）は、±500μm以内であった。

30

【0049】

（封止・分断）

上記で作製した封止基板を、酸素5ppm以下/水分5ppm以下の雰囲気を保ったまま、貼り合せ装置内の塗布ステージにセットした。まず、接着剤をディスペンサシステムによって封止基板内の各パネルの外周シール領域の中央に塗布した。外周シール剤としては、ビーズ等を混入させていない紫外線硬化型エポキシ系接着剤（ナガセケムテックス社製、XNR-5516）を採用した。次に、同装置内で、有機EL基板43と封止ガラス基板42とを向かい合わせ、周囲を90kPa付近まで減圧してから両基板を合せて外周シール剤を接触させ、アライメント（精度：±50μm程度）を行い、その後、周囲圧力を大気圧に戻すことで、これを押しつぶして貼り合せた（図7参照）。封止基板は、ほぼ全面で、陰極隔壁に接する付近まで接近した。

40

【0050】

これを紫外線照射装置にセットして、シール領域に紫外線を照射し、貼り合わせ装置から一般環境に取り出した。その後、全体を80℃で1時間加熱し、接着剤を完全硬化させた。このときの外周シール剤の主要なはみ出し幅は十分小さかったが、陰極隔壁に沿って接着剤が内部に浸入し、補助隔壁部にまで達していた（図1中のXで示す部分）。しかし、補助隔壁部は越えていなかった。

50

【0051】

次に、貼り合わせた基板をスクライプ装置にセットして、封止ガラス基板側を切断位置51にそってスクライプし、有機EL基板側を切断位置52にそってスクライプした後、ブレイク装置によって個々に分断して、外形は図8、内部構造は図1、図2に示すような本発明のパネルを得た。

【0052】

結果として、切り出したパネルの陰極同士の短絡はなく、正常に画像を表示することができた。寿命も従来構造と同等であった。また、額縁および外形については従来構造に比して片側で1mm以上小型化することができ、マザーガラス基板内のパネル取れ数の増加につながった。

10

【0053】

<実施例2>

(封止基板)

封止基板については、実施例1と同様に製作した。

【0054】

(有機EL基板)

厚さ0.7mmの無アルカリガラス基板(コーニング社製, Eagle 2000)に、ブラックマトリックス、カラーフィルタ、色変換層および平坦化層を順次形成した後、これらから出る水分を遮断するための厚さ約1μmのSiNパッシベーション層を、CVD法により形成した。

20

【0055】

上記のようにして製造した基板の上に、実施例1と同様にして、陽極/正孔注入層/正孔輸送層/有機発光層/電子注入層/陰極を順次成膜して、有機EL発光機能を形成した。但し、実施例1のCVD法による無機絶縁膜SiNの代わりに、厚さ約300nmのSiO₂層をスパッタ法により形成した。スパッタ装置としてはRF-プレーナマグネトロンを用い、ガスはArを使用した。以降は実施例1と同様にして、外形は図8、内部構造は図1、図2に示すような本発明のパネルを得た。

【0056】

結果として、実施例2のパネルにおいては、実施例1のパネルと同様に、陰極同士の短絡はなく、正常に画像を表示することができた。寿命も従来構造と同等であった。また、額縁および外形については従来構造に比して片側で1mm以上小型化することができ、マザーガラス基板内のパネル取れ数の増加につながった。

30

【0057】

以上より、本発明のパネルによれば、高精度なマスクやアライメント機構を用いることなく、従来と同等の寿命を維持しつつ、シール領域を内側に移動させることができ、額縁および外形の小型化を実現して、安価な有機ELディスプレイパネルが得られることが明らかである。

【図面の簡単な説明】

【0058】

【図1】(a)は、本発明の有機ELディスプレイパネルの一好適例に係る封止端部の模式的断面図であり、(b)は、その平面構造を模式的に示す説明図である。

40

【図2】図1(b)に示す平面構造の一部を拡大した模式的説明図である。

【図3】本発明に係る補助隔壁部を設けた場合の接着剤の浸入状態を示す写真図である。

【図4】本発明のパネルにおける画素部の断面構造を示す拡大部分断面図である。

【図5】本発明のパネルの製造工程を示す工程図である。

【図6】ザグリ部を複数設けた封止基板を示す概略図である。

【図7】多数取り用基板の場合の封止後のパネル構造を示す概略図である。

【図8】(a)~(c)は、従来の有機ELディスプレイパネルの全体構造を示す概略説明図である。

【図9】(a)は、図8のパネル内部を部分的に拡大して示す模式的断面図、(b)は、

50

このパネル内の平面構造パターンの一例を示す模式図である。

【図 1 0】接着部の形成位置による水分の透過経路の違いを示す模式図である。

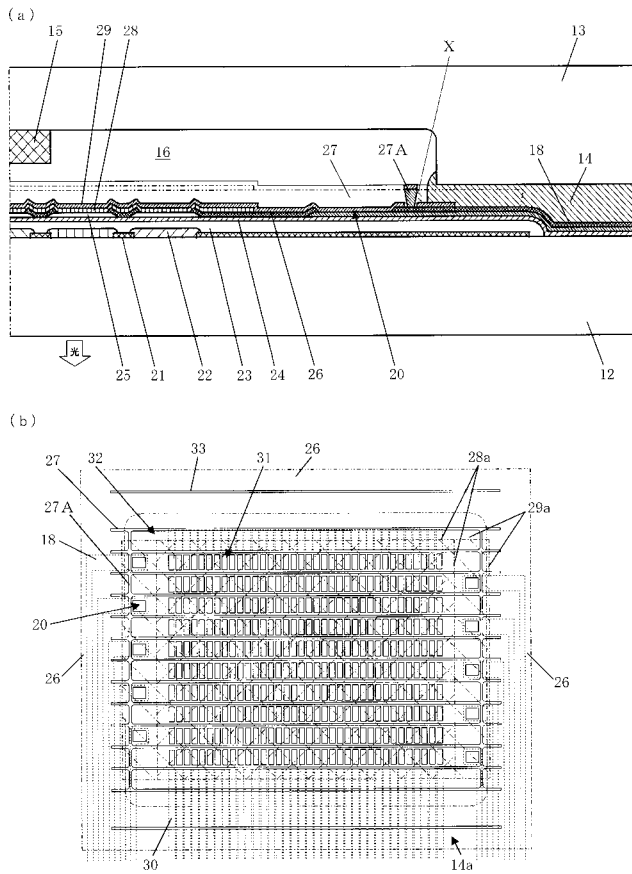
【図 1 1】陰極隔壁に沿って接着剤が浸入する現象を示す写真図である。

【符号の説明】

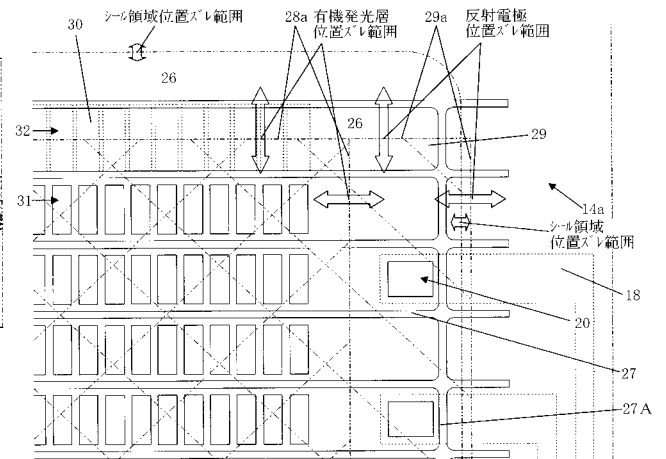
【 0 0 5 9 】

1 2 , 1 1 2	有機 E L 基板 (ガラス)	
1 3 , 1 1 3	封止基板 (ガラス)	
1 4 , 1 1 4	接着部 (シール部)	
1 4 a , 1 1 4 a	シール領域	
1 5 , 1 1 5	吸湿剤	10
1 6 , 1 1 6	ザグリ部	
1 8 , 3 0	外部配線	
2 0 , 1 2 0	電氣的接続部 (陰極接続部)	
2 1 , 1 2 1	ブラックマトリクス (B M)	
2 2 , 1 2 2	カラーフィルタ (C F) または C F + 色変換 (C C M) 層	
2 3 , 1 2 3	平坦化層	
2 4 , 1 2 4	パッシベーション層	
2 5 , 1 2 5	透明電極 (陽極)	
2 6	絶縁膜	
2 7 , 1 2 7	反射電極隔壁 (陰極隔壁)	20
2 7 A	補助隔壁部	
2 8 , 1 2 8	有機発光層	
2 8 a , 1 2 8 a	有機発光層成膜範囲	
2 9 , 1 2 9	反射電極	
2 9 a , 1 2 9 a	反射電極成膜範囲	
3 1 , 1 3 1	発光部開口	
3 2	ダミー走査線部	
3 3	スペーサ	
4 1	ザグリ部	
4 2	封止基板	30
4 3	有機 E L 多数取り用基板	
5 1 , 5 2	切断位置	
1 1 1	有機 E L 等の積層膜	
1 1 7	表示部	
1 1 8	陰極配線 (外部配線)	
1 1 9	電極端子の取り出し部	
1 2 6	有機絶縁膜	
1 3 0	陽極配線	
5 0 0	ブラックマトリクス ~ パッシベーション層までの積層膜	

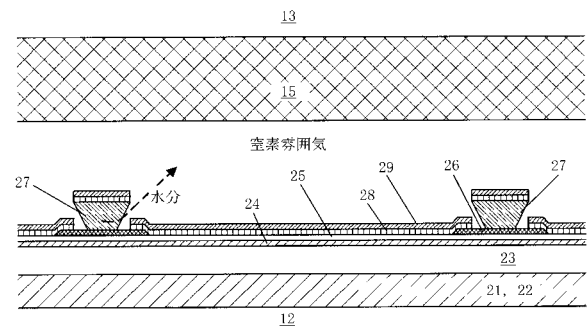
【図 1】



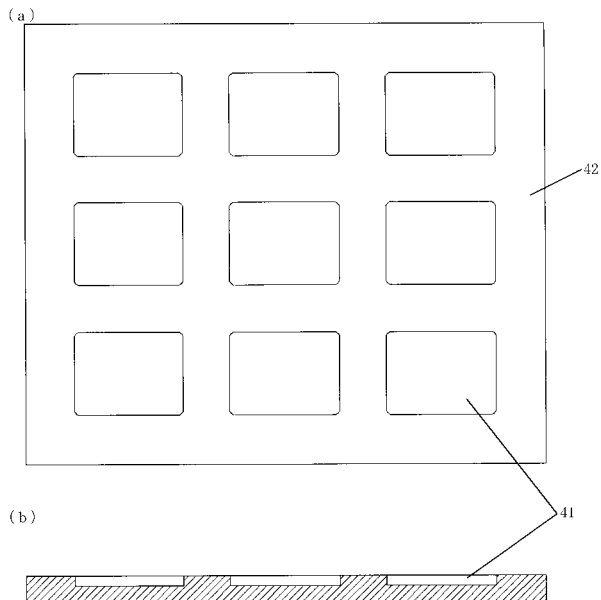
【図 2】



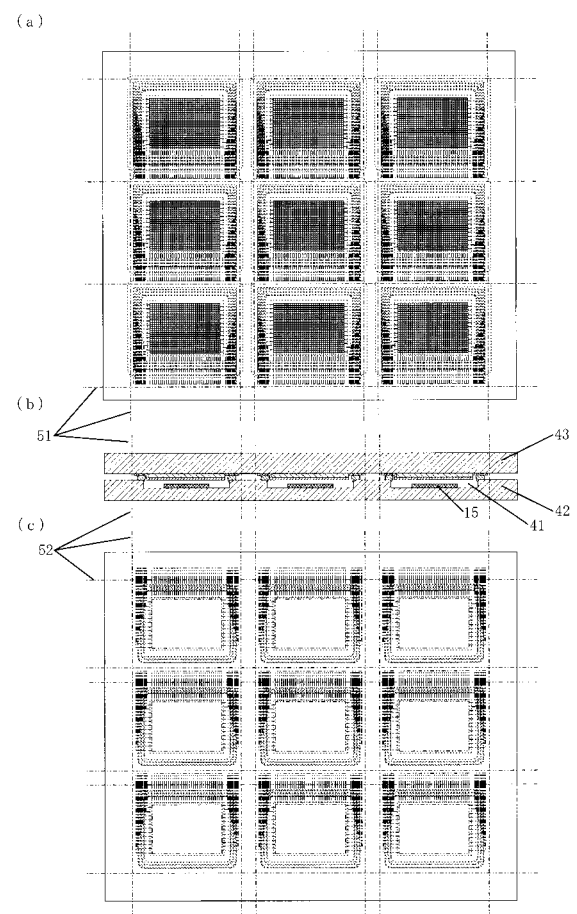
【図 4】



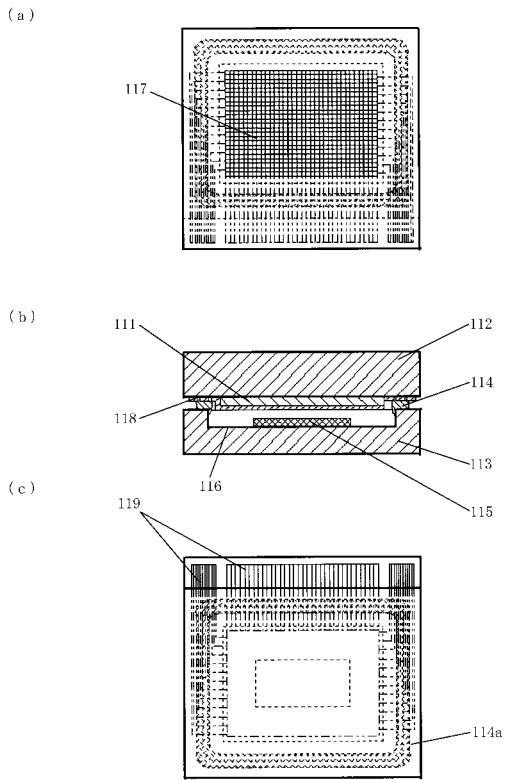
【図 6】



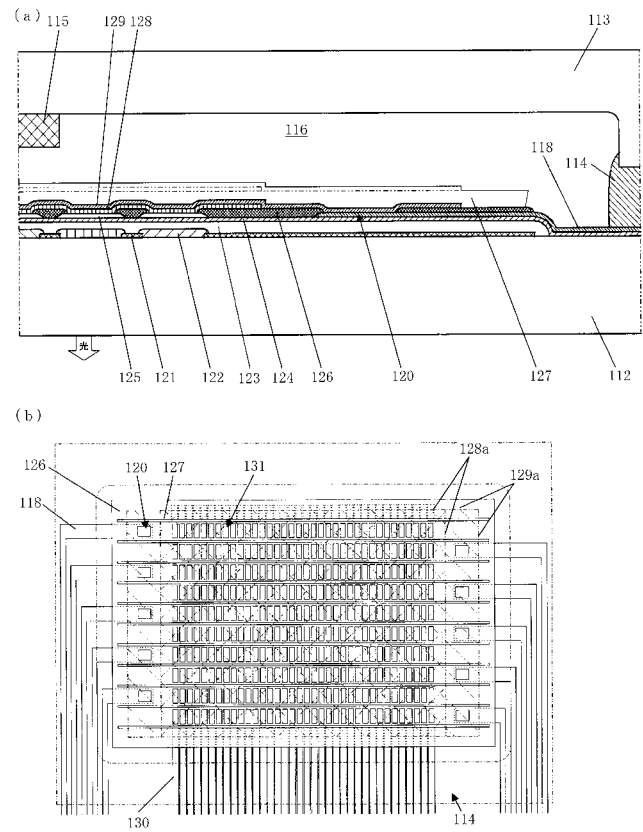
【図 7】



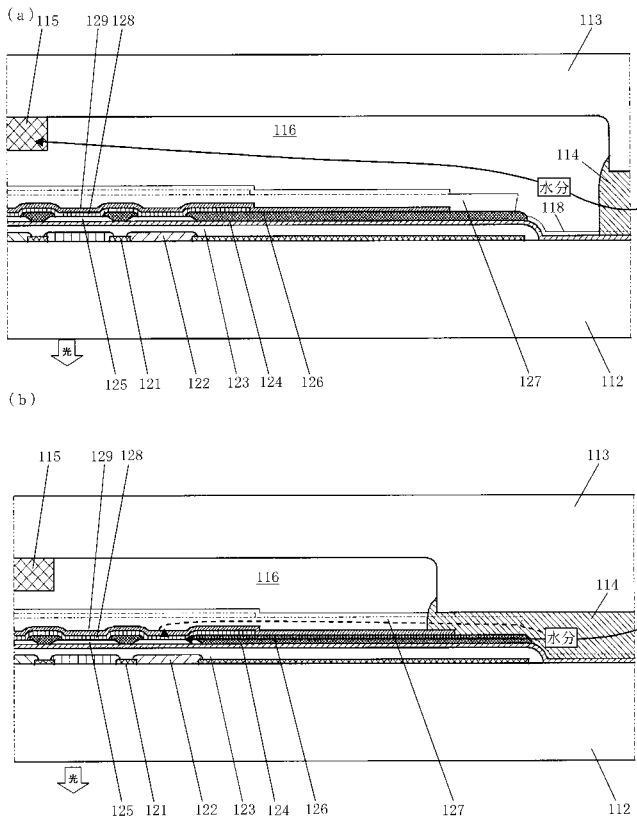
【図 8】



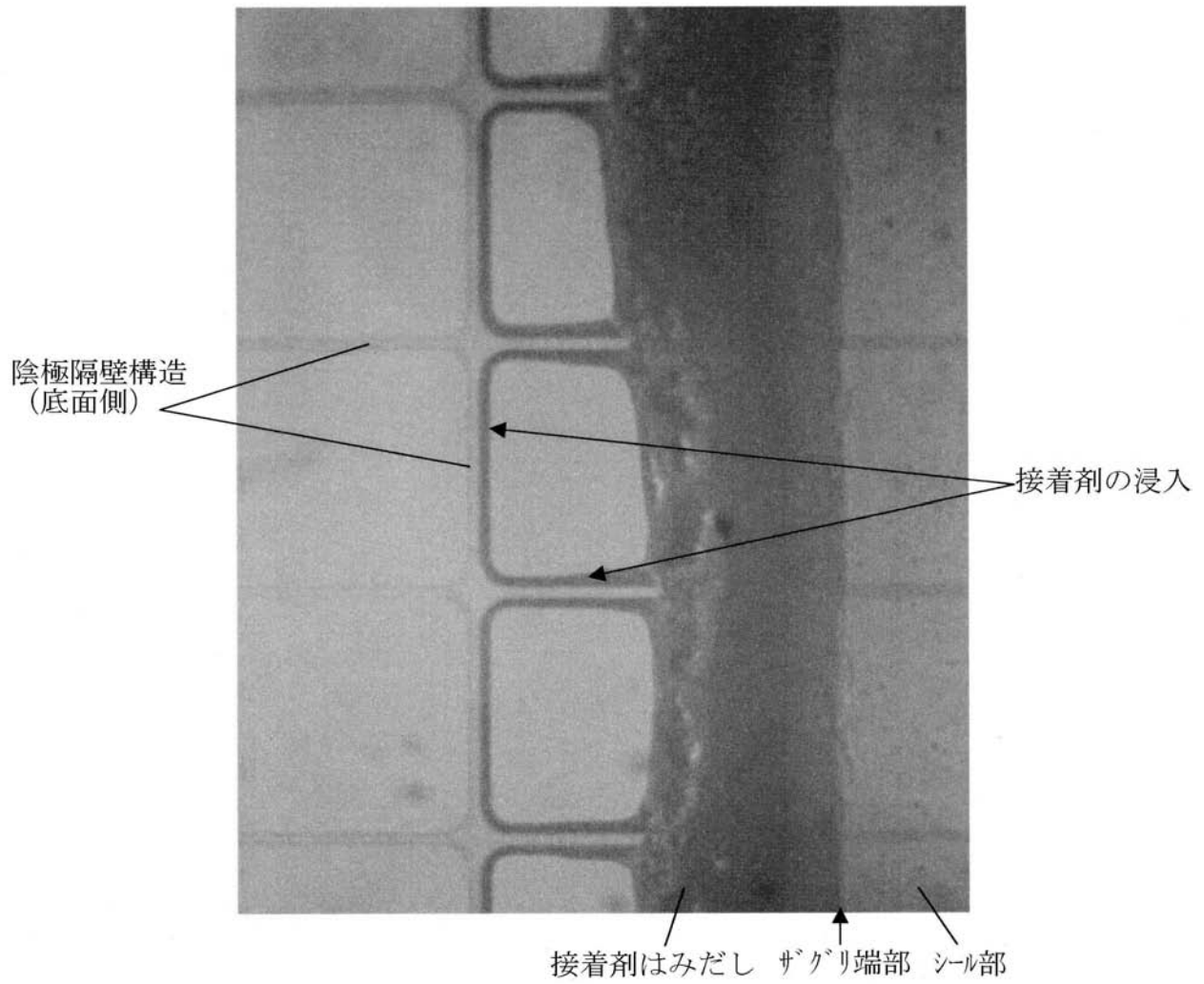
【図 9】



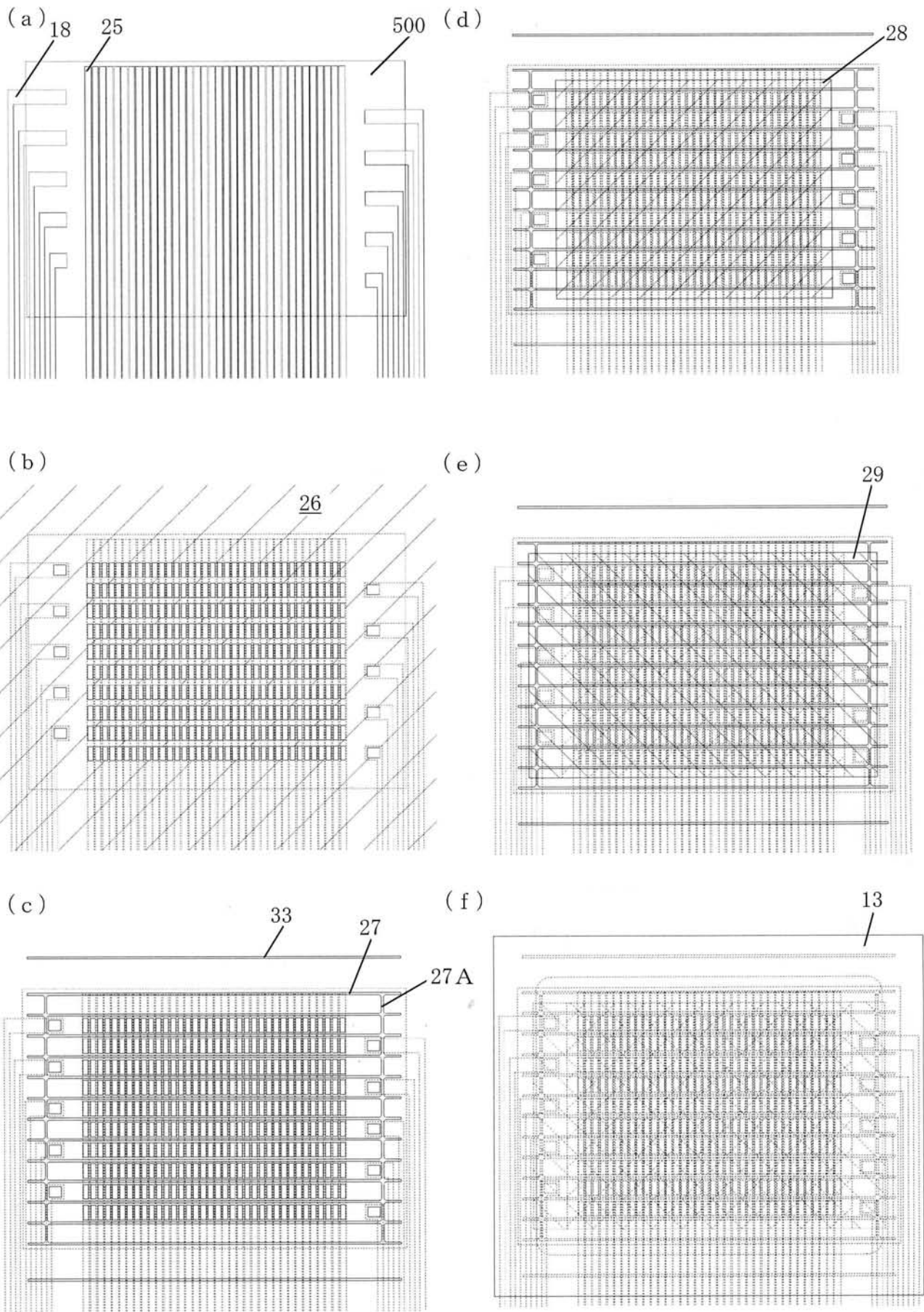
【図 10】



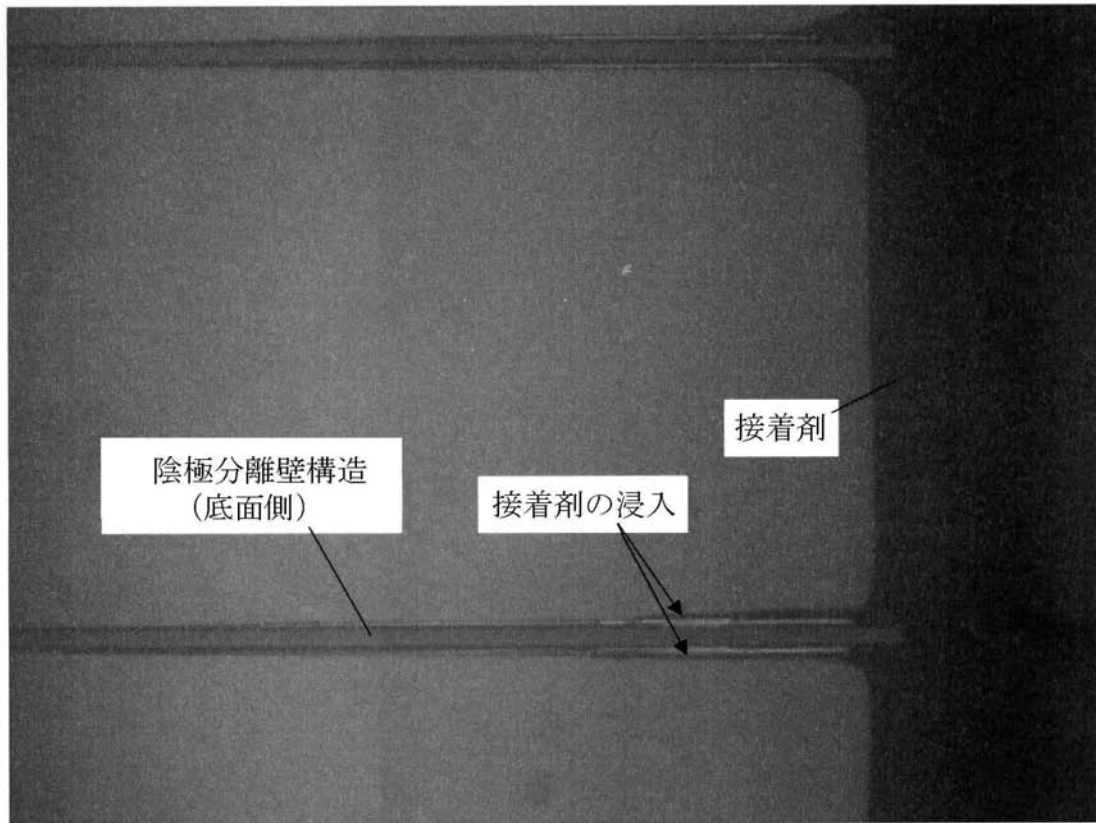
【図 3】



【図 5】



【図 11】



专利名称(译)	有机EL显示屏		
公开(公告)号	JP2009104952A	公开(公告)日	2009-05-14
申请号	JP2007276816	申请日	2007-10-24
[标]申请(专利权)人(译)	富士电机株式会社		
申请(专利权)人(译)	富士电机控股有限公司		
[标]发明人	仲村秀世		
发明人	仲村 秀世		
IPC分类号	H05B33/12 H05B33/22 H05B33/04 H05B33/26 H01L51/50		
FI分类号	H05B33/12.B H05B33/22.Z H05B33/04 H05B33/26.Z H05B33/14.A H01L27/32		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC23 3K107/CC29 3K107/CC43 3K107/CC45 3K107/DD37 3K107/DD89 3K107/DD91 3K107/EE42 3K107/EE55		
代理人(译)	本田一郎		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种易于安装在设备中的有机EL显示板，同时具有长寿命，高产量和低成本，即使使用廉价且不准确的定位装置和掩模。
 ŽSOLUTION：有机EL基板12具有有机EL元件，该有机EL元件依次包括：形成为条形的透明电极25；绝缘膜26划分每个像素的发光区域；反射电极阻挡肋27垂直于透明电极25形成；有机EL层28与反射电极屏障分开；有机EL显示板构造使得有机EL基板和密封基板13通过接合部分14粘合在一起，其中反射电极阻挡层27用作间隔物。密封基板13在接合部14的内部具有沉孔部16，并且反射电极障肋27具有辅助障肋部27A，该辅助障肋部27A在相邻的障肋27之间的端部16的内部位置处垂直地连接。反射部分16a位于反射电极29的电连接部分20的外部 and 外部布线18中

